

微細加工プラットフォーム支援提供装置利用料金表

大阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点 微細加工PF
2017/4/1改定

装置群	装置番号	設備(設備群)名	メーカー・機種	拠点内 愛称	大学・公的機関等		企業等	
					従量制利用料	月極め、月上限料金	従量制利用料	月極め、月上限料金
A群	FA-01	高精細集束イオンビーム装置	ZEISS “ORION NanoFab”	NanoFab	12,000円/4時間	600,000円/月	18,000円/4時間	900,000円/月
	FA-02	多元DC/RFスパッタ装置	キヤノンアネルバ “EB1100”	多元スパッタ				
B群	FB-03	超高精細電子ビームリソグラフィ装置	エリオニクス “ELS-100T”	125KeV	8,000円/4時間	400,000円/月	12,000円/4時間	600,000円/月
	FB-04	SEM付集束イオンビーム装置	ZEISS “Nvision 40D with NPVE”	W-beam				
	FB-05	深掘りエッチング装置	サムコ “RIE-400iPB-NP”	深掘り				
	FB-06	リアクティブイオンエッチング装置	サムコ “RIE-10NR-NP”	10NR				
	FB-07	RFスパッタ成膜装置:金属成膜用	サンヨー電子 “SVC-700LRF”	RFスパッタ metal				
	FB-08	RFスパッタ成膜装置:絶縁体成膜用	サンヨー電子 “SVC-700LRF”	RFスパッタ oxide				
C群	FC-10	電子ビームリソグラフィ装置	JEOL “JSM6500F with Beam Draw”	30KeV	6,000円/4時間	300,000円/月	9,000円/4時間	450,000円/月
	FC-11	集束イオンビーム装置	日立ハイテクサイエンス “SMI2050”	FIB				
	FC-12	リアクティブイオンエッチング装置	サムコ “RIE-10NOU”	10NOU				
	FC-13	EB蒸着装置	アルバック “UEP-2000 OT-H/C”	EB蒸着				
	FC-14	マスクアライナー	ミカサ “MA-10”	アライナ				
	FC-15	LED描画システム	ピーエムティー “PLS-1010”	LED				
	FC-16	イオンシャワーエッチング装置	エリオニクス “EIS-200ER”	イオンシャワー				
	FC-17	ナノインプリント装置	Obducat “Eitre 3”	ナノインプリント				
技術代行料					2,000円/1時間	上限無し	3,000円/1時間	上限無し
クリーンルーム利用料(1ヶ月) 注:クリーンルーム2ヶ所それぞれに課金いたします。					1,000円/人	上限無し	1,000円/人	上限無し